

# 聚氨基甲酸酯合成皮業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準修正草案總說明

聚氨基甲酸酯合成皮業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準（以下簡稱本標準）自八十六年十二月十日發布施行後，歷經八十八年四月七日、九十一年十月十六日、九十二年一月二十九日、一百零四年三月二十三日等四次修正。鑑於揮發性有機物為臭氧與細懸浮微粒的前驅物，也是異味污染的主因之一，且部分揮發性有機物亦為有害空氣污染物，長期暴露會對人體造成健康影響，因此有必要視實際情況予以檢討修正。

依據一百十年空氣污染防制費之申報資料，固定污染源揮發性有機物排放量中，聚氨基甲酸酯合成皮業占表面塗裝製程中第四大占比（百分之十），且製程原物料使用之二甲基甲醯胺具異味，有必要強化揮發性有機物與異味污染物管制，及將揮發性有機物納入公私場所應定期檢測及申報之固定污染源應定期檢測項目。另聚氨基甲酸酯塗布之行為，皆應為本標準管制對象，然現行產業已開始研發水性及無溶劑貼合技術，減少製程中揮發性有機物之排放，爰修正本標準適用對象，排除不含二甲基甲醯胺之水性製程，並將名稱修正為「聚氨基甲酸酯塗布業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，其修正要點如下：

- 一、修正本標準用詞及符號定義。（修正條文第二條）
- 二、納入以聚氨基甲酸酯為原料，塗布或貼合於不同材質基布之製程，另排除不含二甲基甲醯胺之水性製程。（修正條文第三條）
- 三、刪除局部集氣設施及其控制風速規定，改以集氣設施型式規範各操作單元廢氣收集規定。（修正條文第四條）
- 四、加嚴二甲基甲醯胺排放濃度及防制設備處理效率，並新增既存製程與新設製程異味污染物排放標準。（修正條文第五條）
- 五、定期檢測相關規定已於公私場所應定期檢測及申報之固定污染源載明，爰刪除之；另調整各項記錄保存年限與空氣污染防制費收費辦法一致。（修正條文第六條）
- 六、既存製程給予二年改善期限。（修正條文第八條）

# 聚氨基甲酸酯合成皮業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準修正草案條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
聚氨基甲酸酯塗布業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準	聚氨基甲酸酯合成皮業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準	配合適用對象修正，修正法規名稱，並酌作文字修正。
修正條文	現行條文	說明
<p>第一條 本標準依空氣污染防制法第二十條第二項及第二十三條第二項規定訂定之。</p>	<p>第一條 本標準依空氣污染防制法第二十條第二項、<u>第二十二條第二項</u>、<u>第三項</u>及第二十三條第二項規定訂定之。</p>	<p>本行業空氣污染物定期檢測規定，已另於「公私場所應定期檢測及申報之固定污染源」第一項附表四規範，爰刪除之。</p>
<p>第二條 本標準用詞及符號定義如下：</p> <p>一、<u>聚氨基甲酸酯塗布業</u>：指以<u>聚氨基甲酸酯</u>進行塗布或貼合作業，於織布、不織布、皮革、<u>塑膠膜</u>及<u>塑膠布</u>等材質之基布上形成<u>聚氨基甲酸酯膜</u>之行業，包括下列製程：</p> <p>(一)<u>乾式製程</u>：指利用加熱使附著於<u>基材</u>之<u>樹脂</u>熟成<u>固化</u>之製程。</p> <p>(二)<u>濕式製程</u>：指利用凝結、水洗使附著<u>基材</u>之<u>樹脂</u>凝結<u>固化</u>之製程。</p> <p>(三)<u>印刷製程</u>：指於<u>聚氨基甲酸酯</u>基材表層塗布顏料與<u>樹脂</u>混合形成<u>薄膜</u>之製程。</p>	<p>第二條 本標準<u>專用名詞</u>及符號定義如下：</p> <p>一、<u>聚氨基甲酸酯 (Polyurethane，PU)</u>合成皮：指以人工合成方式於織布、不織布及皮革等材質之基布上形成聚氨基脂膜。</p> <p>二、<u>揮發性有機物 (Volatile Organic Compounds，VOCs)</u>：係指有機化合物<u>成份</u>之總稱。但不包括一氧化碳、二氧化碳、<u>碳酸</u>、<u>碳酸鹽</u>、<u>碳酸銨</u>等化合物。</p> <p>三、<u>集氣設施</u>：收集揮發性有機物，以避免其逸散之設施。</p> <p>四、<u>密閉設備</u>：係指密閉揮發性有機物逸散發生源使其不致散布之設備。</p> <p>五、<u>局部排氣裝置</u>：係</p>	<p>一、序文酌作文字修正。</p> <p>二、第一款配合修正第三條，改以聚氨基甲酸酯塗布業定義；並將原第八款、原第九款及原第十三款規定納入本款，爰刪除前述規定。</p> <p>三、第二款配合揮發性有機物空氣污染管制及排放標準規定，統一規範揮發性有機物之定義。</p> <p>四、第三款未修正。</p> <p>五、本次修正刪除「局部集氣設施及其控制風速規定」，新增「集氣設施」管制規範，爰刪除第四款至第六款之名詞定義。</p> <p>六、變更第七款款次為第四款，並修正密閉排氣系統定義，及新增儲槽集氣規範。</p> <p>七、修正第十款回收設備定義，移列為第五款，另本行業主要回收物質為二甲基甲醯胺，故將第十二款內容於本款整併後</p>

<p>二、揮發性有機物：指在一大氣壓下，測量所得初始沸點在攝氏二百五十五度以下有機化合物之空氣污染物總稱。但不包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、碳酸、碳酸鹽、碳酸銨、氰化物或硫氰化物。</p> <p>三、集氣設施：指收集揮發性有機物，以避免其逸散之設施。</p> <p>四、密閉排氣系統：指可捕集儲槽、製程設備或製程設備元件排出或逸散出之揮發性有機物，並輸送至污染防制設備，使捕獲之空氣污染物於輸送過程不直接與大氣接觸之排氣系統。該系統包括管線及連接裝置。</p> <p>五、回收設備：指具有回收物料之功能以減少空氣污染物排放之污染防制設備，其回收量和回收率計算方式說明如下：  <math display="block">\text{回收量} = S - S_0;</math> 單位為kg/hr。  <math display="block">\text{回收率} = \frac{(S - S_0)}{S} \times 100\%</math> S：經密閉排氣系統後，進入回收設備前之污染物質流量率，單位為</p>	<p>指藉動力吸引逸散之揮發性有機污染物後排放之設備。</p> <p>六、控制風速：係指將逸散之揮發性有機物自逸散源有效導入氣罩開口面所需最小流速或抑制其不致從氣罩開口逸失之最小速度。</p> <p>七、密閉排氣系統 (Closed Vent System)：係指可捕集製程設備或製程設備元件排出或逸散出之揮發性有機物，並輸送至污染防制設備，使傳送之氣體不直接與大氣接觸之製程。該系統包括管線及連接裝置。</p> <p>八、乾式製程：指利用加熱使附著於以織布、不織布及皮革等材質為基布上之樹脂熟成固化之製程。</p> <p>九、濕式製程：指利用凝結、水洗使附著於以織布、不織布及皮革等材質為基布上之樹脂凝結固化之製程。</p> <p>十、回收設備：係指具有回收物料之功能以減少因破壞性燃燒產生額外空氣污染物之污染防制設備。</p>	<p>刪除之。</p> <p>八、修正第十一款污染防制設備定義，並整併第十四款內容，移列為第六款。</p> <p>九、第十五款款次移列為第七款。</p> <p>十、因應本次修正新增修正條文第八款「既存製程」及第九款「新設製程」之定義，其判定以本標準修正施行日為據。</p>
--	---	--

kg/hr。

S<sub>0</sub>:經回收設備後逕排大氣之污染物質質量流率,單位為kg/hr。

六、污染防制設備:指處理廢氣之熱焚化爐、觸媒焚化爐、鍋爐或加熱爐等密閉式焚化設施、冷凝器、吸附裝置、吸收塔或其他經中央主管機關認定者,其污染防制設備削減量及揮發性有機物排放削減率計算方式說明如下:

污染防制設備削減量=E-E<sub>0</sub>;單位為kg/hr。

揮發性有機物排放削減率=(E-E<sub>0</sub>)/E×100%;單位為%。

E:經密閉排氣系統後,進入污染防制設備前之揮發性有機物質量流率,單位為kg/hr。

E<sub>0</sub>(排放量):經污染防制設備後逕排大氣之揮發性有機物質量流率,單位為kg/hr。

七、排放濃度:指以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準,單位為ppm。

八、既存製程:指自中華民國○年○月○日以前已完成

十一、污染防制設備:

係指處理廢氣之熱焚化爐、觸媒焚化爐、鍋爐或加熱爐等密閉式焚化設施、冷凝器、吸附裝置、吸收塔、廢氣燃燒塔或其它經中央主管機關認定者。

十二、二甲基甲醯胺

(Dimethyl Formamide,

DMF)回收量及回收率:

二甲基甲醯胺回收量=S-S<sub>0</sub>;單位為kg/hr。

二甲基甲醯胺回收率=(S-S<sub>0</sub>)/S×100%;單位為%。

S:經密閉排氣系統後,進入回收設備前之二甲基甲醯胺質量流率,單位為kg/hr。

S<sub>0</sub>:經回收設備後逕排大氣之二甲基甲醯胺質量流率,單位為kg/hr。

十三、印刷製程:指於

聚氨基甲酸酯合成皮表層塗布顏料與樹脂混合形成薄膜之製程。

十四、污染防制設備

削減量及揮發性有機物排放削減率:

污染防制設備削

<p><u>工程招標程序、未經招標程序已完成工程發包簽約、建造中或完成建造之製程。</u></p> <p>九、<u>新設製程：指自中華民國○年○月○日後設立之製程，及既存製程符合固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第四條規定之變更者。</u></p>	<p><u>減量=E-E<sub>0</sub>；單位為kg/hr。</u></p> <p><u>揮發性有機物排放削減率=(E-E<sub>0</sub>)/E×100%；單位為%。</u></p> <p><u>E：經密閉排氣系統後，進入污染防治設備前之揮發性有機物質量流率，單位為kg/hr。</u></p> <p><u>E<sub>0</sub>（排放量）：經污染防治設備後逕排大氣之揮發性有機物質量流率，單位為kg/hr。</u></p> <p>十五、<u>排放濃度：係以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準，單位為ppm。</u></p>							
<p>第三條 <u>本標準適用於聚氨基甲酸酯塗布業。但以水為稀釋溶劑，揮發性有機物重量含量比在百分之十以下，且未使用二甲基甲醯胺者，報經直轄市、縣（市）主管機關認可後，得不適用本標準。</u></p>	<p>第三條 <u>本標準適用於聚氨基甲酸脂合成皮業之乾式、濕式及印刷製程。</u></p>	<p>修正適用對象及酌作文字修正，並為鼓勵源頭減少揮發性有機物使用，增訂不適用本標準之對象。</p>						
<p>第四條 <u>聚氨基甲酸酯塗布業製程之廢氣收集規定如附表一。</u></p>	<p>第四條 <u>聚氨基甲酸脂合成皮製程中所裝置之揮發性有機物逸散局部集氣設施，其控制風速應符合下表規定：</u></p> <table border="1" data-bbox="619 1854 954 2042"> <tr> <td data-bbox="619 1854 715 1989"><u>氣罩之型式</u></td> <td data-bbox="715 1854 842 1989"><u>控制風速（公尺/每秒）</u></td> <td data-bbox="842 1854 954 1989"><u>備註</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1989 715 2042"><u>包圍型氣</u></td> <td data-bbox="715 1989 842 2042"><u>○.四</u></td> <td data-bbox="842 1989 954 2042"><u>控制風速係指</u></td> </tr> </table>	<u>氣罩之型式</u>	<u>控制風速（公尺/每秒）</u>	<u>備註</u>	<u>包圍型氣</u>	<u>○.四</u>	<u>控制風速係指</u>	<p>一、酌作文字修正。</p> <p>二、將聚氨基甲酸酯塗布製程各操作單元及操作作業之廢氣收集規定，改為集氣設施型式判定，以附表一臚列規定；並刪除現行集氣設施控制風速規定。</p>
<u>氣罩之型式</u>	<u>控制風速（公尺/每秒）</u>	<u>備註</u>						
<u>包圍型氣</u>	<u>○.四</u>	<u>控制風速係指</u>						

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="606 185 710 224">罩</td> <td data-bbox="710 185 766 224"></td> <td data-bbox="766 185 845 224"></td> <td data-bbox="845 185 949 224">開放全</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 224 710 380">外裝型氣罩</td> <td data-bbox="710 224 766 380">側向吸引式</td> <td data-bbox="766 224 845 380">○.五</td> <td data-bbox="845 224 949 380">部氣罩時之控制風速。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 380 710 537"></td> <td data-bbox="710 380 766 537">下向吸引式</td> <td data-bbox="766 380 845 537">○.五</td> <td data-bbox="845 380 949 537">包圍型氣罩風速係指氣罩開口面任一點之</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 537 710 1149"></td> <td data-bbox="710 537 766 1149">上向吸引式</td> <td data-bbox="766 537 845 1149">○.八</td> <td data-bbox="845 537 949 1149">最低風速。外裝型氣罩控制風速係指氣罩吸引揮發性有機物逸散範圍內，距該氣罩開口面最遠距離之作業位置之最低風速。</td> </tr> </table>	罩			開放全	外裝型氣罩	側向吸引式	○.五	部氣罩時之控制風速。		下向吸引式	○.五	包圍型氣罩風速係指氣罩開口面任一點之		上向吸引式	○.八	最低風速。外裝型氣罩控制風速係指氣罩吸引揮發性有機物逸散範圍內，距該氣罩開口面最遠距離之作業位置之最低風速。	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="710 1149 766 2024">適用對象</td> <td data-bbox="766 1149 845 2024">空氣污染物</td> <td data-bbox="845 1149 949 2024">排放標準</td> <td data-bbox="949 1149 1037 2024">施行日期</td> </tr> </table>	適用對象	空氣污染物	排放標準	施行日期	<p>第五條 乾式製程及印刷製程之塗佈機烤爐、處理機烤爐及濕式製程之配料室、塗佈單元等之排氣中，二甲基甲醯胺之排放及揮發性有機物（不含二甲基甲醯胺）每月全廠之排放應符合下表規定之排放標準。但排放管道排氣採非破壞性物料回收處理方式，其揮發性有機物排放削減率達八十五%以上或以甲烷為計算基準之排放濃度三〇〇ppm以下者，不在此限。</p> <p>一、第一項表格內容已於附表二規範，爰刪除表格內容。 二、第二項及第三項內容已於附表二備註敘明，爰刪除之。</p>
罩			開放全																				
外裝型氣罩	側向吸引式	○.五	部氣罩時之控制風速。																				
	下向吸引式	○.五	包圍型氣罩風速係指氣罩開口面任一點之																				
	上向吸引式	○.八	最低風速。外裝型氣罩控制風速係指氣罩吸引揮發性有機物逸散範圍內，距該氣罩開口面最遠距離之作業位置之最低風速。																				
適用對象	空氣污染物	排放標準	施行日期																				
<p>第五條 <u>依前條規定收集<u>集聚氨基甲酸酯塗布業製程產生之廢氣</u>，應導入空氣污染防制設備處理，視空氣污染物種類，其處理效率或排放濃度應符合附表二規定，始得排放。</u></p>																							

	<p>發布日</p> <p>連至染制備理排中甲甲胺含不超連至染制備理之十。氣理二基醃回率去效九%上二基醃排濃二○ppm以下。</p> <p>未通污防設處之氣二基醃總量得過通污防設處者二%集處之甲甲胺收或除率十以或甲甲胺放度○ppm以下。</p>	<p>甲甲胺 二基醃</p>	<p>八十六年十二月三十一日以前設立之聚氣基甲酸酯合成皮製程</p>
	<p>發布日</p> <p>廠放揮性機排標應合九</p>	<p>揮性機(不 含二基 甲甲 胺)</p>	
	<p>九十六</p> <p>廠放揮</p>	<p>全排之</p>	

	年一月一日	性機排標應合二 發有物放準符一 ○ g/m <sup>2</sup> 。		
	發布日	連至染制備理排中甲甲胺含 未通污防設處之氣二基醃總量得過通污防設處者二%集處之甲甲胺收或除率十以或甲甲胺放度○ ppm 下。	八十七年一月一日以後設立之聚氣基甲酸酯合成皮製程	
	發布日	廠放揮性機排 全排之發有物	揮性機(不 含二 甲	



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="686 185 766 347">基甲 醃 胺)</td> <td data-bbox="766 185 877 347">放 準 符 六 g/m<sup>2</sup>。</td> <td data-bbox="877 185 957 347">標 應 合 五</td> </tr> </table>	基甲 醃 胺)	放 準 符 六 g/m <sup>2</sup> 。	標 應 合 五	
基甲 醃 胺)	放 準 符 六 g/m <sup>2</sup> 。	標 應 合 五			
<p>第六條 <u>聚氨基甲酸酯塗布業揮發性有機物及二甲基甲醃胺</u>排放之記錄、保存及申報應符合下列規定：</p> <p>一、每月記錄各製程產品產量與製程所使用溶劑、樹脂或其他<u>含揮發性有機物</u>物料之總量及隨製程廢溶劑、廢棄物、廢水或其他物料排放之揮發性有機物之總量、二甲基甲醃胺</p>	<p>前項揮發性有機物排放標準之計算，係以每月全廠之乾式製程塗佈、貼合程序、濕式塗佈再經乾式製程貼合程序及印刷製程程序所使用之揮發性有機物(不含二甲基甲醃胺)使用量，分別除以各製程程序產品產量(以面積表示)所得值之總和。</p> <p><u>第二項之塗佈程序</u>，係指利用刮刀或滾輪將聚氨基甲酸酯樹脂溶液均勻分布於離型紙、織布、不織布或皮革等基材上，經烘乾後，在其表面上形成聚氨基酯膜之作業；貼合程序，係指以接著劑、滾輪及烘箱將兩種材質黏合之作業。</p> <p>第六條 揮發性有機物及二甲基甲醃胺排放之記錄、保存及申報應符合下列規定：</p> <p>一、每月記錄各製程產品產量與製程所使用溶劑、樹脂或其他物料中含揮發性有機物之總量及隨製程廢溶劑、廢棄物、廢水或其他物料排放之揮發性有機物之總量、二甲基甲醃胺回收</p>	<p>一、序文修正適用對象。</p> <p>二、第一款酌作文字修正。</p> <p>三、第二款至第六款未修正。</p> <p>四、第七款定期檢測規定已另於公私場所應定期檢測及申報之固定污染源附表四規範，爰刪除之，並酌作文字修正。</p> <p>五、為建構資料記錄之一致性，第八款各記錄保存年限調整為六年。</p>			

<p>回收量或削減量等資料。</p> <p>二、回收設備為洗滌回收者，每日記錄各洗滌槽洗滌循環水量、循環水溫度及回收液量。</p> <p>三、回收設備為冷凝回收者，每日記錄回收液量及冷凝液進、出口溫度。</p> <p>四、污染防制設備為熱焚化爐者，每日記錄燃燒溫度及廢氣風量。</p> <p>五、污染防制設備為觸媒焚化爐者，記錄觸媒種類、觸媒床更換日期，並每日記錄廢氣風量、觸媒床進、出口氣體溫度。</p> <p>六、以其他污染防制設備處理者，每日記錄主要操作參數。</p> <p>七、第一款至前款之使用、操作紀錄需保存至少<u>六年</u>，並依中央主管機關規定之格式於每年一、四、七、十月月底前向直轄市、縣(市)主管機關申報上一季之紀錄。</p>	<p>量或削減量等資料。</p> <p>二、回收設備為洗滌回收者，每日記錄各洗滌槽洗滌循環水量、循環水溫度及回收液量。</p> <p>三、回收設備為冷凝回收者，每日記錄回收液量及冷凝液進、出口溫度。</p> <p>四、污染防制設備為熱焚化爐者，每日記錄燃燒溫度及廢氣風量。</p> <p>五、污染防制設備為觸媒焚化爐者，記錄觸媒種類、觸媒床更換日期，並每日記錄廢氣風量、觸媒床進、出口氣體溫度。</p> <p>六、以其他污染防制設備處理者，每日記錄主要操作參數。</p> <p>七、<u>污染防制設備處理前後之二甲基甲醯胺濃度、排放量每年至少需檢測一次，檢測時需記錄當時製程及處理設備之操作條件。每一濃度測點之檢測頻率每小時至少檢測一個樣品，檢測時程至少需四小時。檢測報告需含所測得濃度之總平均值表</u></p>	
---	---	--

	<p><u>列及小時平均值表列。計算防制設備削減率及排放總量，採用所測得濃度之總平均值。</u></p> <p>八、第一款至前款之使用、操作及檢測紀錄需保存至少二年，並依中央主管機關規定之格式於每年一、四、七、十月月底前向直轄市、縣(市)主管機關申報上一季之紀錄。</p>	
	第七條 (刪除)	<u>本條刪除。</u>
第七條 本標準未規定事項適用其他相關標準之規定。	第八條 本標準未規定事項適用其他相關標準之規定。	條次變更。
<p>第八條 既存製程應自中華民國○年○月○日起，符合本標準規定。</p> <p>既存製程屆期未能符合前項規定而需進行製程設施或污染防制設備更新、汰換等工程者，公私場所得於前項期限前，檢具空氣污染改善計畫，向直轄市、縣(市)主管機關申請核定改善期限，並應於期限屆滿前完成改善，改善期限最長不得逾○年○月○日。</p> <p>前項空氣污染改善計畫內容至少應包含製程設施或防制設備改善種類、構造、效能、流程、設計圖說、設置經費及進度。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、因應第四條各操作單元之廢氣收集規定，以及第五條揮發性有機物之處理效率規定，給予既存製程二年期限改善，明定既存製程應自○年○月○日起符合本標準規定。</p>
第八條 本標準自發布	第九條 本標準除另定	一、條次變更。

日施行。	<u>施行日期者外</u> ，自發布日施行。	二、本次修正未另定施行日期，爰酌作文字修正。
------	------------------------	------------------------

## 第四條附表一修正對照表

修正規定		現行規定				說明
附表一						
		集氣設施				
		既存製程		新設製程		
		水性	其他	水性	其他	
操作單元	配料區	一般氣罩	包圍式操作	一般氣罩	密閉負壓操作	
	塗布區					
	凝結槽					
	水洗槽					
	貼合區					
烘乾區		密閉負壓操作				
儲槽區 (儲存物料屬「固定污染源空氣污染防治費收費率」公告之個別物種或公告毒性化學物質者)		儲槽上方呼吸口或通氣口應裝設密閉排氣系統連通至污染防制設備處理				
操作作業		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聚氨基甲酸酯原料/調配桶於操作狀態下，需加蓋且覆蓋率<math>\geq 90\%</math>。</li> <li>• 二甲基甲醯胺回收設備（洗</li> </ul>				

- 一、本附表新增。
- 二、新設與既存公私場所於操作單元需減少揮發性有機物逸散，惟考量低溶劑之水性製程較無揮發性有機物逸散風險，故僅需使用一般氣罩收集廢氣。集氣設施名稱依控制效率之條件予以分類，並參考「公私場所固定污染源申報空氣污染防治費之揮發性有機物之行業製程排放係數、操作單元(含設備元件)排放係數、控制效率及其他計量規定」附表第一項第三款，使集氣設施之名稱一致。
- 三、新增公私場所於操作作業應遵循之操作行為，原料與配料桶於操作狀態下需加蓋及二甲基甲醯胺回收設備應保持密閉，以減少揮發性有機物逸散情形。
- 四、新增備註說明密閉負壓操作與包圍式操作之操作樣態。

	滌設備)之補水槽,管線貫穿處不可有縫隙。上方蓋子維持緊閉,非必要不得開啟		
<p>備註1:密閉負壓操作:圍封空間內之污染排放區域符合負壓操作並設有壓力監測儀表者,或圍封空間內之污染排放區域及人員或物料進出口處符合負壓操作並設有壓力監測儀表者。</p> <p>備註2:包圍式操作:污染源設置一般型氣罩且有圍幕設施者或設置包圍型氣罩者。</p>			

## 第五條附表二修正對照表

修正規定			現行規定	說明
附表二				
二甲基甲醯胺	導入空氣污染防制設備處理之二甲基甲醯胺回收率或去除效率 90% 以上或二甲基甲醯胺排放濃度 10 ppm 以下。			一、本附表新增。
揮發性有機物	全廠排放之揮發性有機物排放標準應符合 $65 \text{ g/m}^3$ (不含二甲基甲醯胺)			二、二甲基甲醯胺屬公告毒性化學物質且為本行業產生異味主因，爰調整二甲基甲醯胺排放濃度。
	既存製程	新設製程		三、揮發性有機物為臭氧與細懸浮微粒前驅物，且本行業為揮發性有機物重要排放源，爰增訂揮發性有機物排放濃度與削減率之管制規範。
	導入空氣污染防制設備處理之揮發性有機物回收率或去除效率 90% 以上或揮發性有機物排放濃度 150 ppm 以下。	導入空氣污染防制設備處理之揮發性有機物回收率或去除效率 95% 以上及揮發性有機物排放濃度 150 ppm 以下。		四、考量產業製程特殊性容易產生異味，爰依固定污染源空氣污染物排放標準附表一，新增異味污染物排放標準，並強化新設製程異味管制。
異味污染物	管道高度 h (公尺)	既存製程	新設製程	五、第五條第二項及第三項內容移列於附表二備註，俾利查閱。
	$h \leq 18$	1,000	800	
	$18 < h \leq 50$	2000	1600	
	$50 < h$	4000	3200	
備註 1：全廠揮發性有機物排放標準之計算，指以每月全廠之乾式製程塗布、貼合程序、濕式塗布再經乾式製程貼合程序及印刷製程程序所使用之揮發性有機物（不含二甲基甲醯胺）使用量，分別除以各製程程序產品產量（以面積表示）所得值之總和。				

備註 2：前項之塗布程序，指以利用刮刀或滾輪將聚氨基甲酸酯樹脂溶液均勻分布於離型紙、織布、不織布、皮革、塑膠膜或塑膠布等基材上，經烘乾後，在其表面上形成聚氨酯膜之作業；貼合程序，指以以接著劑、滾輪或烘箱將兩種材質黏合之作業。